

**미주전류가 발생하는 구간에서의 음극방식전위 기준에 대한 연구**  
**Studies on the Cathodic Protection Criteria in the Presence of Stray Current**

백원종\*, 정구진, 하윤철, 강 탁, 손현준 (서울대학교)

박경완 (한국가스공사 연구개발원)

### 1. 서 론

부식에 의한 경제적 손실<sup>[1]</sup> 및 안정성에 대한 문제는 이미 널리 인지되고 있으며 이러한 구조물의 부식문제를 억제하기 위하여 일반적으로 음극방식법을 사용하고 있다. 하지만 음극방식이 이루어지고 있는 구조물 주위에 또 다른 음극방식계 또는 전철역 등의 전류원이 존재하게 되면 미주전류의 영향으로 인해 적절한 방식이 이루어지지 않고 부식을 일으킬 수 있다<sup>[2]</sup>. 실제 도심권의 한 전철역 주변에 방식이 이루어지고 있는 매설배관은 미주전류의 영향에 의하여 배관 전위가 일정하게 유지되지 못하고 임의의 과형을 보이면서 변화하게 된다. 이 때 나타나는 전위변화는 일반적으로 평균전위와 표준편차를 갖는 Gaussian분포를 나타낸다. 본 연구에서는 방식이 이루어지고 있는 매설배관이 미주전류에 의하여 그 전위가 임의로 변화하는 조건에서의 부식현상을 알아보고 이 경우의 적당한 방식기준을 제시하고자 하였다.

### 2. 실험 방법

본 연구에서 작동전극으로 사용된 재료는 실제 사용되는 매설배관과 같은 종류인 저탄소강이며 기준전극으로 칼로멜전극, 보조전극으로는 백금판 또는 탄소판을 사용하였다. 전해질 용액은 전도도가 약 1.28 mS/cm가 되는 NaCl 용액을 사용하여 일반 토양에서 나타나는 비교적 낮은 전도도 환경을 구현하였다. 임의파형전위를 인가하는 실험에 앞서 부식산물의 환원 가능성은 알아보기 위해 EG&G PARC model 273A를 이용하여 규칙적인 사각파형전위를 인가하되 그 상한전위, 하한전위 그리고 주파수를 변화시켜 가면서 이 때 나타나는 부식산물의 환원율을 조사하였다. 임의파형의 전위를 인가하기 위하여 Hewlett Packard사의 HP 33120A Function Generator/Arbitrary Waveform Generator와 EG&G PARC model 273A를 사용하였으며 실제 방배역 주변의 방식중인 매설배관의 전위측정 자료를 근거로 하여 평균전위, 표준편차, 그리고 빈도수를 변화시켜 가면서 일정시간 실험을 행하여 이 때 나타나는 부식량을 측정. 같은

시간에 해당하는 자연부식량과 비교하였다.

### 3. 결과 요약

- 1) 사각파형의 전위를 인가하여 산화 전류량에 대한 실제 부식량의 비율을 살펴본 결과 전체적으로 평균전위가 감소할수록 그 비율도 감소하였으나 진폭전위 변화에 대해서는 큰 차이를 나타내지 않았다. 이는 하한전위의 값이 비교적 낮은 영역에 위치 할수록 전극근처의 pH가 증가하며 이로 인해 부동태 부식산물의 형성과 이의 환원율이 증가하기 때문이다.
- 2) 기준전극과 작동전극간의 전압강하 영향이 없는 조건에서 전극전위가 임의의 파형을 가지며 변화할 때 전체적으로 평균전위, 표준편차, 그리고 빈도수가 낮을수록 그 부식량은 감소하는 경향을 나타내었다. 주파수가 1 Hz일 때 평균전위가 -0.78 V에서는 표준편차가 약 50 mV이하에서, 평균전위가 -0.88 V에서는 표준편차가 약 80 mV이하에서, 평균전위가 -0.98 V에서는 표준편차가 약 115 mV이하에서 자연부식량의 10% 이내에 해당하였다. 한편 기존의 방식전위(-0.77 V vs. SCE)보다 높은 평균전위를 나타낼 때에는 비교적 작은 표준편차 조건에서도 상당한 부식이 일어남을 확인할 수 있었다.

### 참고 문헌

- [1] <http://www.nace.org/naceframes/government/costcor.htm>
- [2] Evans, U. R. Metallic Corrosion, Passivity and Protection 3rd. ed., Edward Arnold, Sevenoaks (1981)